

NJCX

iLitho

Strict Lithography Simulation

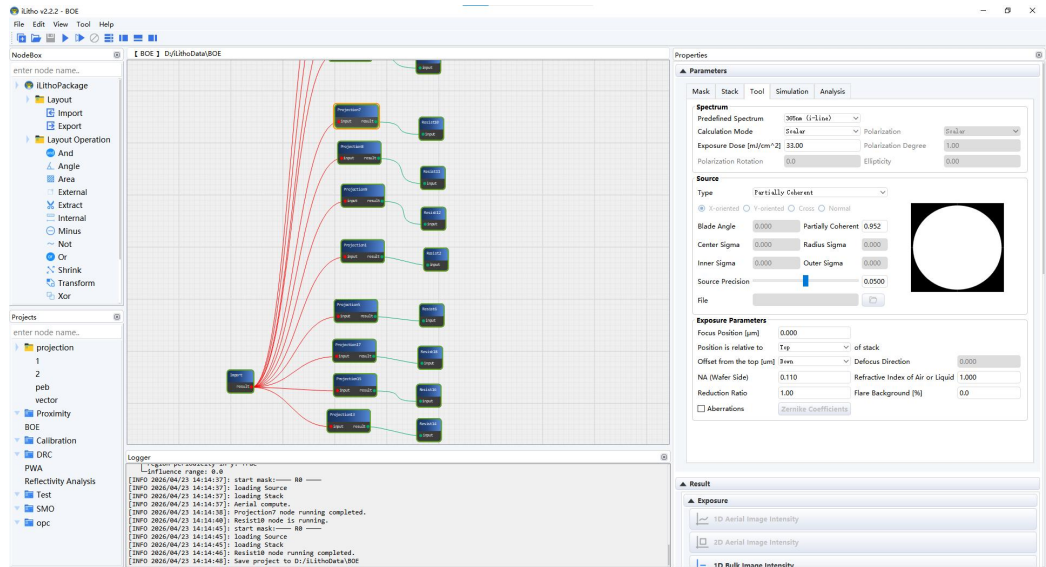
and Layout Optimization



iLitho

Strict Photolithography Simulation and Layout Optimization

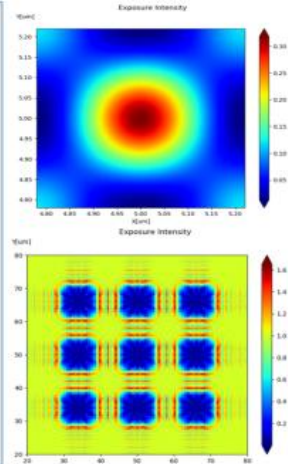
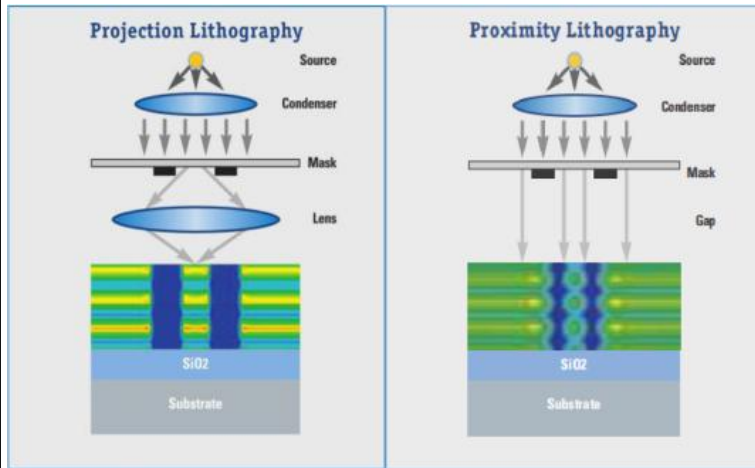
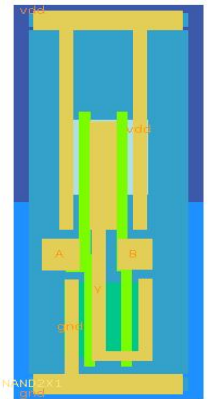
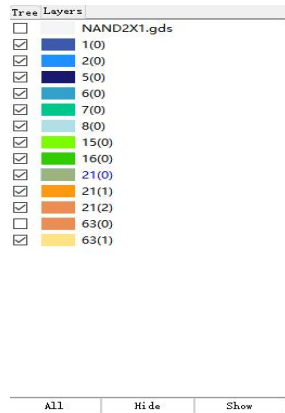
iLitho 是一款为半导体从业者、科研人员、高校师生准备的高效仿真工具，可以实现集成电路领域和平板显示领域的严格光刻仿真与版图优化，具有快速、精确性高、易用性的特点。



光学临近效应导致光刻曝光成像畸变，而解决成像畸变的方法可以为传统方法或仿真方法，传统解决方案为：工艺研发、光刻胶评估、材料选型和掩模版图优化等；而 iLitho 仿真解决方案为：光学仿真+版图优化，其优势在于：更短的时间！更低的成本！且 iLitho 作为制造领域国产化的 EDA 工具，其完全自主可控、并能够满足用户需求下的升级，更加贴近用户需求！

图形操作包括：

- ✓ 测试图形生成
- ✓ 版图查看、量测
- ✓ 版图抽取、变换
- ✓ 版图布尔运算





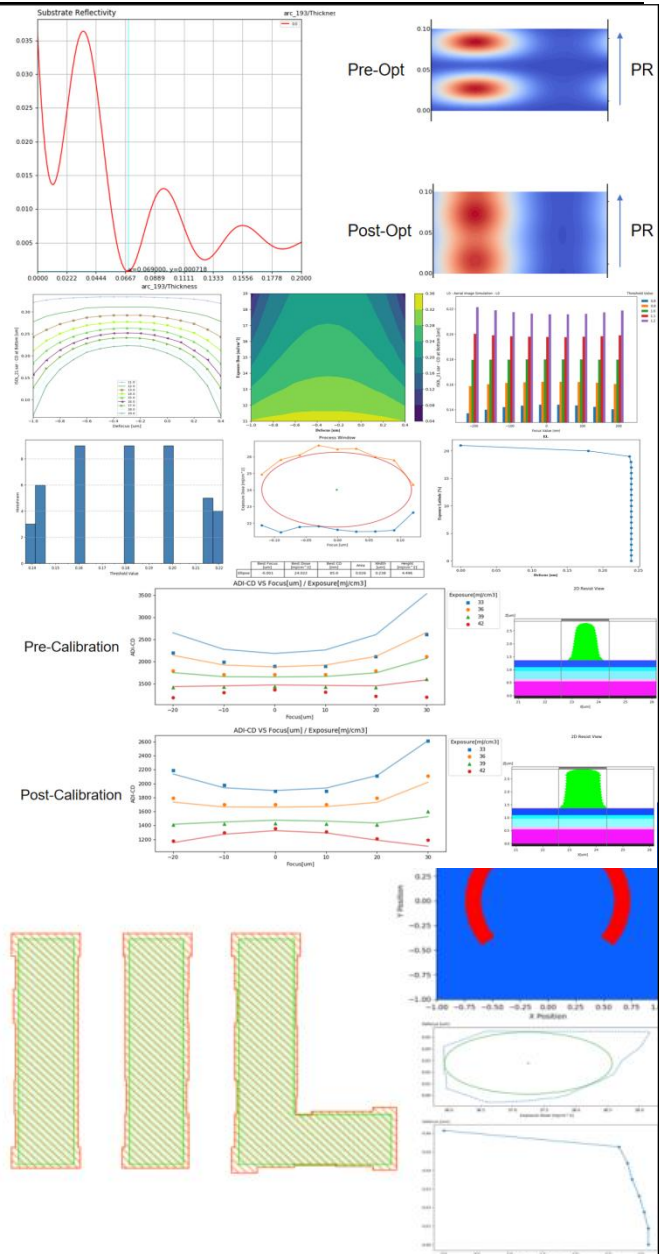
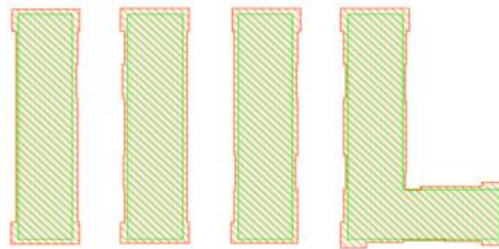
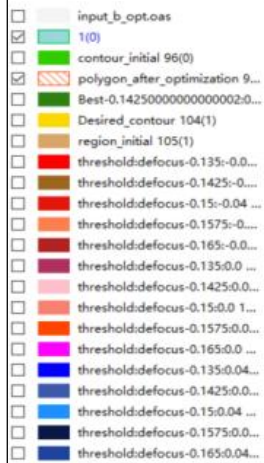
iLitho

Strict Photolithography Simulation and Layout Optimization

iLitho 是一款为半导体从业者、科研人员、高校师生准备的高效仿真工具，可以实现集成电路领域和平板显示领域的严格光刻仿真与版图优化，具有快速、精确性高、易用性的特点。

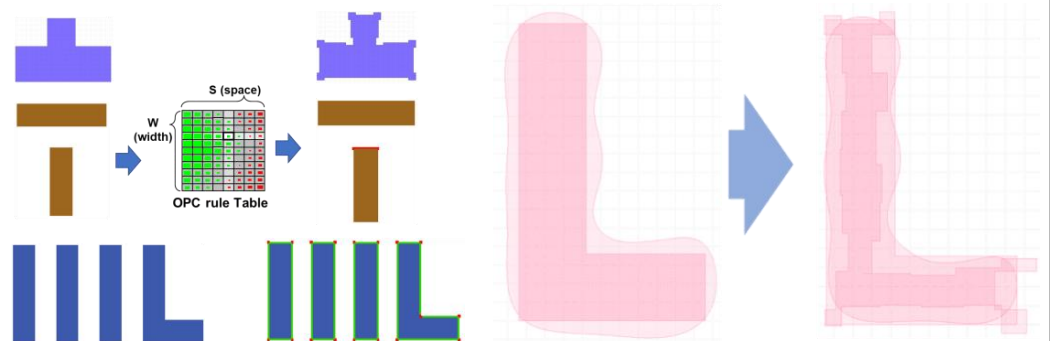
光刻建模包括：

- ✓ 投影式光刻仿真
- ✓ 接近式光刻仿真
- ✓ 光刻曝光显影仿真
- ✓ 工艺窗口分析
- ✓ 工艺叠层反射率分析
- ✓ 多参数 Loop 分析
- ✓ 光刻参数 Calibration
- ✓ 光源-掩模联合优化



掩膜优化包括：

- ✓ 基于规则的 OPC
- ✓ 基于模型的 OPC





iLitho

Strict Photolithography Simulation
and Layout Optimization